

2021 年 10 月 22 日

関係各位

株式会社パテント・リザルト

**殺菌・殺カビ剤技術 特許総合力
トップ 3 は BAYER、イビデン、住友化学**

弊社はこのほど、2021 年 10 月 7 日までに日本の特許庁で公開された「殺菌・殺カビ剤技術」について、特許分析ツール「Biz Cruncher」を用いて参入企業に関する調査結果をまとめ、レポートの販売を開始しました。

殺菌・殺カビ剤はヒト、植物などの感染症対策として広く使われており、各企業は抗菌性の増大、抗菌性の維持などの課題に取り組んでいます。

今調査では日本の特許庁で公開されている「殺菌・殺カビ剤技術」(FI=A01P 3/00)全般について、個別特許の注目度を得点化する「パテントスコア」をベースに、特許の質と量から総合的に見た評価を行いました。

集計をした結果、「総合カランキング (注 1)」は、1 位 **BAYER**、2 位 **イビデン**、3 位 **住友化学**となりました (表 1、図 1)。

【表 1：殺菌・殺カビ剤技術 特許総合力トップ 5】

順位	企業名	総合力 (権利者スコア)	有効特許件数	個別力 (最高スコア)
1	BAYER	610.4	152	66.3
2	イビデン	543.4	36	74.4
3	住友化学	455.8	209	76.4
4	BASF	406.7	60	82.3
5	日本曹達	331.9	108	76.9

1 位 **BAYER** の注目度の高い特許には、「作物の植物病原性菌類を予防的又は治療的に防除する方法」や「殺菌活性を有する微量栄養素含有活性成分を用いて植物の質を改善する方法」などが挙げられます。

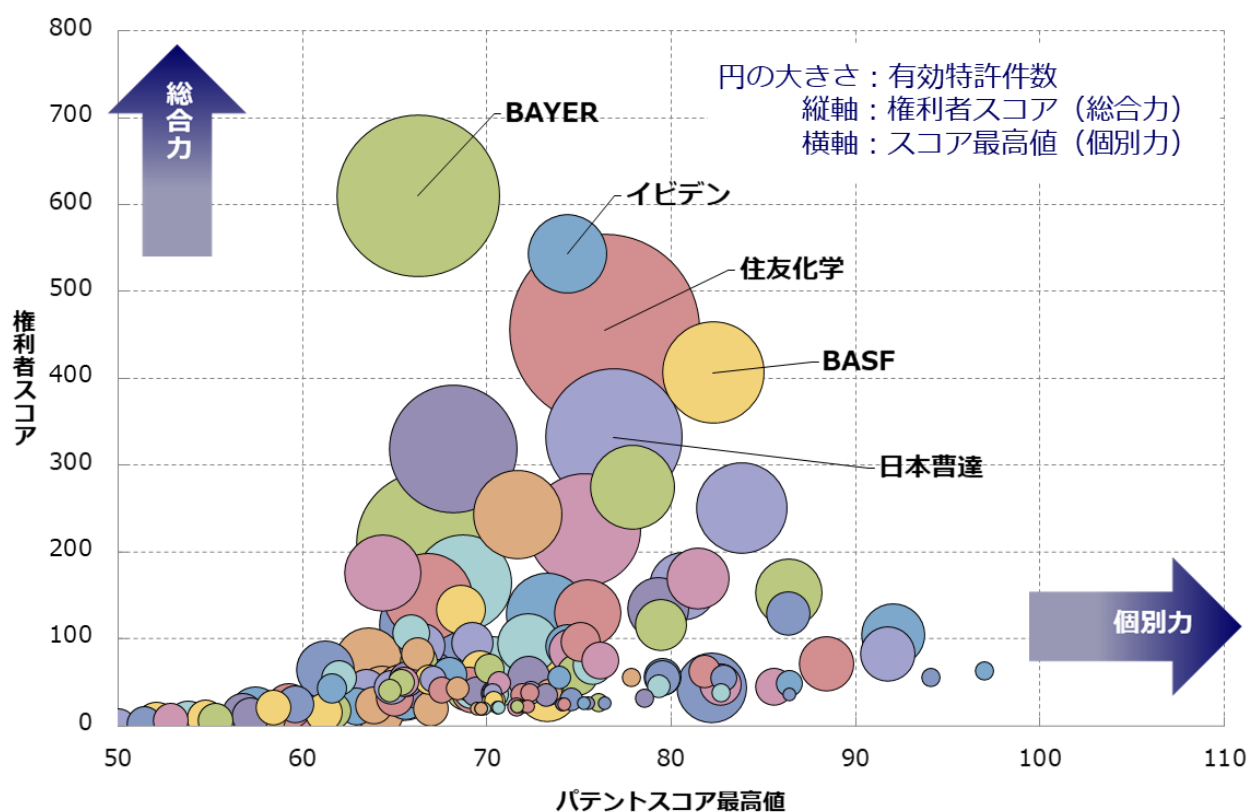
2 位 **イビデン** の注目度の高い特許には、「ウィルスや細菌が液体や気体などの流体などに含まれていても、抗菌性、抗ウィルス性等の効果に優れた化粧板」や「人体や掃除用具等がその表面とよく接触する環境下にあっても、抗菌性、抗ウィルス性等の効果を経長期間に渡って維持することが可能な化粧板」などが挙げられます。

3 位 **住友化学**は「高い活性を有する植物病害防除組成物および植物病害を効果的に防除し得る方法」や「優れた性能を有する水性懸濁状農薬組成物」などが注目度の高い特許として挙げられます。

4 位 **BASF** は「ポリアミンとの組合せで殺生物剤を含む抗微生物組成物、殺生物剤の抗微生物活性を増強するための方法」などが、5 位 **日本曹達**は「優れた殺菌活性を有し、安全性に優れ、且つ工業的に有利に合成できる新規なグアニジン化合物」などが注目度の高い特許として挙げられます。

その他企業では、**大阪ガスケミカル**、**三井化学アグロ**、**花王**などが上位にランクインしています。

【図 1：殺菌・殺カビ剤技術 特許総合力トップ 5】



本分析の詳細につきましては、特許・技術調査レポートの「殺菌・殺カビ剤技術」にてご覧いただけます。

(注 1) 総合力の評価では、個別特許の注目度を得点化する「パテントスコア」を機関ごとに集計し、パテントスコアが 50 点以上のものを合算しています。50 点以上のものだけを集計している理由は、パテントスコアが低くても特許件数が多いことによって総合力が上がってしまうことを防ぐためです

【調査対象の特許群について】

1993年から2021年10月7日までに発行された特許が対象。公開、登録、公表、再公表のすべてが対象で、登録と、公開・公表・再公表が重複している場合は、登録を優先しています。企業等は権利者ベースで集計しています。

【価格】

内 容		価 格（税 抜）	納 期
特許・技術調査レポート		10万円	5営業日
個別企業分析 (レポート追加オプション)	1～5社まで (社数に関わらず同一価格)	+ 20万円	+ 5営業日
	6社目以降、1社当たり	+ 4万円	+ 1営業日

※個別企業分析の対象企業は、特許総合力上位企業または任意にご指定可能です。

※レポートは、弊社データベースにおける最新の収録範囲に基づいて作成致します。

そのため、ご発注のタイミングによっては当リリースと値等が異なる可能性があります。

【納品形態】

冊子1冊。CD-ROMにレポートのPDF、分析に使った特許リスト（Excelファイル）を収録。レポートの収録内容およびサンプルは下記のリンク先をご参照ください。

<https://www.patentresult.co.jp/report/index.html>

*** 本件に関するお問い合わせ先 ***

株式会社パテント・リザルト 事業本部 営業グループ

TEL : 03-5802-6580

FAX : 03-5802-8271

HP : <https://www.patentresult.co.jp/>